

СОДЕРЖАНИЕ

Том 43, номер 4, 2014

ПРИБОРЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Ячейка энергонезависимой памяти на эффекте резистивного переключения в оксидных пленках $\text{Hf}_x\text{Al}_{1-x}\text{O}_y$

*О. М. Орлов, А. А. Чуприк, А. С. Батулин, Е. С. Горнев, К. В. Булах,
К. В. Егоров, А. А. Кузин, Д. В. Негров, С. А. Зайцев,
А. М. Маркеев, Ю. Ю. Лебединский, А. В. Зabloцкий*

243

Исследование электрофизических свойств МДП-структур с пленками нитрида кремния, легированными редкоземельными элементами

А. А. Ковалевский, А. С. Строгова, Н. С. Строгова, Н. В. Бабушкина

250

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Верификация алгоритма эмиссионной томографии плазменных неоднородностей в плазмохимическом реакторе с помощью ленгмюровского мультizonда

А. В. Фадеев, К. В. Руденко

256

Виртуальный растровый электронный микроскоп. 3. Полуэмпирическая модель формирования сигнала РЭМ

Ю. А. Новиков

263

МАТЕРИАЛЫ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Формирование архитектуры наноразмерных полимерных сред с квантовыми точками

В. Я. Подвигалкин

275

Высокомодовые волновые рельефы в рамках пространственно-нелокальной модели эрозии

А. С. Рудый, А. Н. Куликов, Д. А. Куликов, А. В. Метлицкая

282

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Исследование диффузии бора, фосфора и мышьяка в кремнии при отжиге в неизотермическом реакторе

В. И. Рудаков, В. В. Овчаров, В. Ф. Лукичев, Ю. И. Денисенко

289

Модификация электронных свойств поверхности кристаллов кремния (100) при СВЧ-плазменной микрообработке

Р. К. Яфаров, С. А. Климова

305

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Методика анализа эквивалентности рентгенограмм микросхем для задач оценки радиационной стойкости

Ю. А. Ожегин

315
